Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ



Группа _	P3110	Дата и время измерений
Студент	Щербаков Александр Валерьевич	Работа выполнена
Препода	ватель <u>Коробков Максим Петрович</u>	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабараторной работе № 3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде

- 2. Задачи решаемые при выполнении работы.
 - 1. Проведение измерений потенциала электрического поля
 - 2. Построение сечения эквипотенциального поля по полученным данным
 - 3. Построение графиков зависимости потенциала от координаты для двух экспериментов
 - 4. Формулировка выводов

3. Объект исследования

Электростатическое поле

4. Метод эксперементального исследования

Метод моделирования

5. Рабочие формулы и исходные данные

 $\langle E_{12} \rangle \approxeq rac{arphi_1 - arphi_2}{\ell_{12}},$ - средняя напряженность между двумя точками, лежащими на одной силовой

линии

$$ec{E}(ec{r}) = rac{ec{F}(ec{r})}{q}, \;$$
 - вектор напряженности

$$arphi(ec{r}) = rac{W_\Pi(ec{r})}{q}$$
 - вектор потенциала в данной точке

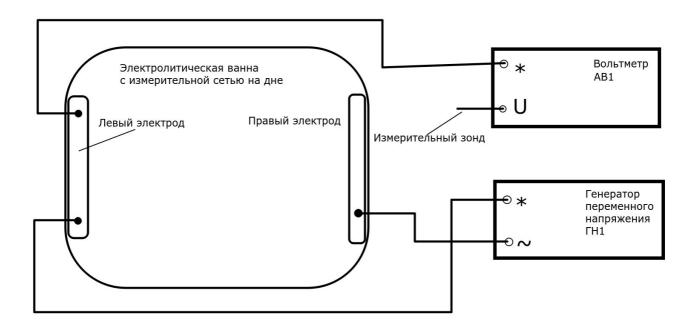
$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi \equiv -\vec{\nabla}\varphi,$$

- связь напряженности и потенциала электростатического поля
$$arphi_2-arphi_1=-\int\limits_{\cdot}^2 \vec{E}d\vec{\ell}.$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Измеряемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	Цифровой	1 — 14 B	0,01 B
2	Разлинованная сеть на дне электролитической ванны	Аналоговый	2 — 18 см 2 — 28 см	2,5 мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1)



8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Рисунок 1 – сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии.

Рисунок 2 – сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии.

(с помещённым в поле металлическим проводникм)

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Для модели плоского конденсатора по формуле рассчитаем величину напряженности в центре электролитической ванны и в окрестности одного из электродов.

$$E_{12} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l_{12}}$$

$$E_{\rm u} = \frac{7,25 B - 6,25}{0,042} \approx 23,8 B' \,\mathrm{M}$$

$$E_{o\kappa} = \frac{11,25 B - 10,25 B}{0,018 M} \approx 55,5 B/M$$

Оценим поверхностную плотность электрического заряда на электродах

$$\sigma' \approx -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_n}$$

$$\sigma_{1}^{'} \approx -8.85*10^{-12} \frac{2.25}{0.03} = 7.5*10^{-10} \frac{Kn}{M^{2}}$$

$$\sigma_{2}^{'} \approx -8.85*10^{-12} \frac{1.25}{0.022} = 5.6*10^{-10} \frac{Kn}{M^{2}}$$

Для конфигурации поля при наличии проводящего кольца найдём на построении области с минимальной Emin и максимальной Emax напряженностью.

 E_{min} =0 B/M - внутри кольца

 $E_{\it max}$ = 275 B/M - вблизи внешней окружности кольца

10. Расчет погрешности измерений (для прямых и косвенных измерений)

$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\chi_{12}} = \frac{a}{b} \qquad \Delta a = \sqrt{\left(\frac{\partial a}{\partial \varphi_1} \Delta \varphi_1\right)^2 + \left(\frac{\partial a}{\partial \varphi_2} \Delta \varphi_2\right)^2} = \sqrt{\Delta \varphi_1^2 + \Delta \varphi_2^2} \qquad \Delta a \approx \Delta \varphi \sqrt{2}$$

тогда $\Delta a = 0,14$

$$\Delta b = \sqrt{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2} = \Delta x \sqrt{2}$$
 Тогда $\Delta b \approx 0035$

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln E}{\partial a} \Delta a\right)^{2} + \left(\frac{\partial \ln E}{\partial b} \Delta b\right)^{2}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{a}\right)^{2} + \left(\frac{\Delta b}{b}\right)^{2}} \qquad \varepsilon_{x} = \frac{\Delta E}{E} * 100 \%$$

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{0,14}{4}\right)^2 + \left(\frac{0,0035}{0,095}\right)^2} = 0,051$$
 $\varepsilon_x \approx 5,3 \%$ и $\Delta E \approx 1,6$ - в центре ванны

$$\Delta E = \sqrt{\left(\frac{0,14}{2}\right)^2 + \left(\frac{0,0035}{0,032}\right)^2} = 0,094$$
 $\varepsilon_x \approx 9,4 \%$ и $\Delta E \approx 5,4$ - в окрестности электрода

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

Рисунок 1 — сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии Рисунок 2 — сечение эквипотенциальных поверхностей и силовые линии (с внедрением в поле металлического проводника)

12.Окончательные результаты

Напряженность внутри кольца, помещенного в электролитическую ванну, равна нулю, даже когда вне кольца напряженность больше нуля.

Максимальная напряженность была зафиксированна вблизи помещенного в электролитическую ванну кольца.

$$E_{\rm u}$$
=(23,8 ± 0,8) $\frac{B}{M}$, $\varepsilon_{\rm x}$ =3,8 % , α =0,95 - в центре ванны

$$E_{o\kappa}$$
 =(55,5 ± 1,3) $\frac{B}{M}$, ε_{κ} =3,8 % , α =0,95 - в окрестности одного из электродов

$$E_{\it min}$$
=0 B/M - внутри кольца

$$E_{\it max}$$
 = 275 B/M - вблизи внещней окружности кольца

13.Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была построена модель электрического поля в виде схемы эквипотенциальных поверхностей и виловых линий электо-магнитного поля.

14. Дополнительные задания

15.Выполнение дополнительных заданий

16.Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт)

